

真空チャンバー ホットプレート PH221



■ 特徴



- ・チャンバー構造ホットプレート(最高温度200℃)
- ・ホットプレートに真空チャンバーを組み合わせたタイプ
- ・低真空環境での加熱工程を簡易に実現いたします。
- ・チャンバー構造、サイズなどカスタマイズ可能です。
- ・ホットプレート温度分布 ±2.0%
- ・プログラム式温度コントローラー(別売)により、温度プログラム設定が可能。

■ アプリケーション例

真空環境でのプロセス、脱泡工程、ベーキングなど簡易な方法で、真空加熱プロセスが可能です。

■ 構造および原理

温度プログラム例

プログラム式コントローラー(PCC107)への接続例

■ 仕様およびカスタマイズ

	スペック(標準)	カスタマイズ設定
温度設定範囲	50-200℃	250℃タイプ
ヒーター容量	AC100V、400W程度(□200mmサイズ)	AC200V
ホットプレートサイズ	□150~□250mm	1mm単位で変更可能
ホットプレート表面処理	アルマイト(プレートキズ防止)	テフロン(付着防止)
ケーブル	PCC-0505(ホットプレート側に配線片端)	
真空チャンバー構造		カスタム対応
適合温度コントローラー	PCC100,PCC107、PCC100co、PCC107Co	

お客様の仕様によりカスタマイズ可能です。